

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文

前處理對二氧化鈣閘極介電層特性的影響



**Impact of Pre-treatments on the
Properties of HfO_2 Gate Dielectric**

研 究 生：金立峰

指 導 教 授：崔秉鉞 教授

中華民國九十四年七月

前處理對二氧化鈪(HfO₂)閘極介電層特
性的影響

**Impact of Pre-treatments on the
Properties of HfO₂ Gate Dielectric**

研究生：金立峰

Student : Li-Feng Chin

指導教授：崔秉鉞

Advisor : Bing-Yue Tsui



A thesis
Submitted to Institute of Electronics
College of Electrical Engineering and Computer Science
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirement
for the Degree of Master of Science
in
Electronic Engineering
July 2005
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十四年七月